



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN (1183/19)

Fecha y hora de celebración

26 de septiembre de 2019; 10:30 horas

Lugar de celebración

Salón de actos del CSIC

Asistentes

PRESIDENTA

Dña. María del Carmen González Peñalver, Secretaria General Adjunta de Obras e Infraestructura

VOCALES

D. Ricardo Pastor García, Vocal Servicios Jurídicos

Dña. Silvia Losada Viejo, Interventora Delegada en la AECSIC

SECRETARIO

D. Alexis Pejkovich Pejkovich, Jefe de Servicio de Procedimiento Negociado

ORDEN DEL DÍA:

1.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159): 1183/19 - Suministro e instalación de un sistema de plasma para el ataque seco de capas microelectrónicas mediante la técnica de grabado iónico reactivo (RIE) con destino al Instituto de Microelectrónica de Barcelona

SE EXPONE

1.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159): 1183/19 - Suministro e instalación de un sistema de plasma para el ataque seco de capas microelectrónicas mediante la técnica de grabado iónico reactivo (RIE) con destino al Instituto de Microelectrónica de Barcelona

Se procede a la apertura de el sobre de la empresa que ha sido admitida:

LICITADOR: B79255659

Razón social: ANAME S.L.

Fecha de presentación: 25-09-2019 13:41

La documentación aportada por el licitador es trasladada a la Oficina Técnica de Equipamiento para su correspondiente evaluación por los técnicos.

Yo, como Secretario certifico con el visto bueno del Presidenta:

D. Alexis Pejkovich Pejkovich,
SECRETARIO

Dña. María del Carmen González Peñalver
PRESIDENTA

CSV : GEN-a0be-90bf-f02b-6ebb-02fa-ce78-8ddd-c6fc

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : ALEXIS PEJKOVICH PEJKOVICH | FECHA : 27/09/2019 08:29 | Certifica

FIRMANTE(2) : M.CARMEN GONZALEZ PEÑALVER | FECHA : 27/09/2019 08:43 | Certifica

